

高温型ゲル・ペーミエーション・クロマトグラフの開発

馬 場 信 行
竹 島 直 俊*
橋 本 勉

High Temperature Gel Permeation Chromatograph

Nobuyuki BAMBA
Naotoshi TAKESHIMA
Tsutomu HASHIMOTO

A new type high temperature gel permeation chromatograph with a total modular design, the Toyo Soda HLC-811 series, has been developed. With an improved circuitry and high sensitive detector, this model offers a rapid analysis at variable temperature ranging from room temperature up to 150°C and consistently high performance. An important feature of this series is its shorter response time as compared with the previous ones, which would enable users to save the cost for GPC monitoring of process and quality.

The present article is intended to illustrate the major features of the new model, theory of its operation, and some problems of interest encountered during the development research.

1. まえがき

液体クロマトグラフィーの一分野であるゲル・ペーミエーション・クロマトグラフ (G.P.C) はとくに新しく開発された技術ではなく、1950年頃には分子ふるいによるゲル汎過法として、カラム充てん剤にデキストリンやゼラチン、寒天などを用い、たん白質、ペプチド、多糖類など生体高分子の分子量測定などに用いられていた。

GPC が公式に発表されたのは1964年であるが、それ以前に J. C. Moore によって口頭で 2 度発表されている。1つは1962年8月 Gordon Conference, 1つは1962年12月 Dallas で催された polymerization Symposiumにおいてである。いずれもカラム充てん剤にポリスチレンジビニルベンゼン共重合体ゲルを用い、ポリスチレンの分子量を分別、測定した結果であり非常に反響を呼んだ。が理論的にもかなりうまく分子量分布を測れそうだということで認められた形になった。それは他の方法で得られた結果と良く一致する結果が出たためであり、彼によって名づけられた GPC の今日における発展の糸口でもあった。その後充てん剤であるポリスチレン

ゲルも改良され、プラスチック、ゴム、繊維など合成高分子の分子量測定法として普及し、最近はさらに適用領域を広めオリゴマ、低分子量領域、高沸点有機物の分離法として使用されている。さらに最近では新水性ゲルで高分離能カラムが市販されるに至り、水系、有機系を問わず、各種試料の分子量分布を容易に、短時間に知ることができるようになった。これは、1970年代前半より大巾に発展した、高速、高圧下で用いることの出来る高分離能充てん剤の開発、そしてそのハードウェアの開発に依るところが大である。

GPC の基本原理を単純に考えると、カラム内に充てんされたゲル粒子は構造的に 3 次元網目構造を有し、この中に細孔 (pore) があり、試料高分子のふるい分け作用を利用する、すなわち、溶質分子の大きいものは小さなものより早く溶出し、溶出分子の移動速度はその分子の大きさに依存することになる。

GPC は、カラム分別法、光散乱法による沈澱濁度測定法、超遠心分離法のようにきわめて長い測定時間と高度の技術、さらに複雑な計算を一切必要とせず、再現性よいデータから、試料高分子の分子量分布あるいは大き

* 旭計器工業(株)北九州工場

さの分布に関する情報が確実に得られる点で将来性ある測定手段と言えよう。

以上に鑑み、東洋曹達では1974年6月より GPC 専用機として高速液体クロマトグラフ HLC-801 を発売、逐次改良を施し HLC-801A, HLC-802 など常に GPC 分野の最先端をいく装置を提供し、多くの分析化学者に用いられている。しかしながら現在市販されている GPC 装置は高速ではあるが高温では用いられないという問題があった。今回新しく開発した高温 GPC システムは室温から高温まで幅広く使用できる装置である。

本報告は、主として装置の構成、原理を中心に、我々が HLC-811 を開発する途上得た経験をも含めて報告したいと考える。

2. 高温GPC (HLC-811形) 装置とその動作原理の概要

GPC 装置の主要部分は、ソルベントタンク、レベルゲージ、脱ガス器、定流量ポンプ、脈動防止器、フィルタなどからなる送液系、複数のカラムを収納し、かつ試料注入部を内蔵したオープン槽、オープン槽に熱風を吹き出す熱風発生機、カラムによって分離された試料高分子の成分濃度を溶媒との屈折率差として検出する示差屈折計、溶出量を報知するため溶出曲線上に一定溶出量ごとにパルス信号を送りだすマーカ系、オープンや屈折計を始め各部の温度を一定に保持するための温調器、検出器やマーカ、操作部などの電気系の各系である。

HLC-811 ではとくに装置の立上時間を短縮するためにカラム槽と熱風発生機とを独立させ PRE, MAIN ヒータによる制御を行なう。熱容量の大きなバルブボックスを廃止しオープン槽内に格納する、溶媒交換の早い脈動防止器の採用などを行ない、かつ安全性、信頼性の向上のため温調器はすべて2重安全形の採用、送液ラインの密閉とドレン部の集中化、送液流路のオーバプレッシャー対策も十分考慮し設計した。さらに実際測定される試料のうち特に分子量が大きく、かつ分布の広い試料による流路系でのつまりやカラム内での圧力変化に影響されず常に信頼性あるデータが得られる様、温度分布の均一化、接続配管の短縮化、レファレンス、サンプル両流路が完全に独立した2ポンプシステムによる送液流路を設けた。

Fig. 1 は東洋曹達、高温 GPC 装置 HLC-811 外観写真であり、**Fig. 2** に構成概要を示す。

[1] 送液系

送液系の主要部分は、溶媒タンク、レベルゲージ、脱気装置、ラインフィルタ、定量小形ポンプ、アキュムレ

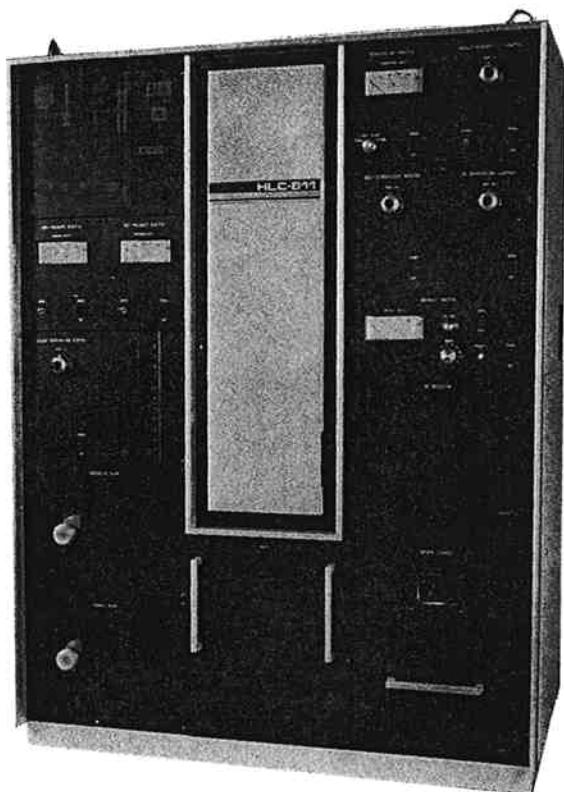


Fig. 1 General view of TSK Gel permeation chromatograph HLC-811

ータ、圧力センサなどで構成される。これらは耐蝕性を考慮し SUS 316 を使用した。

(1) 溶媒タンク

装置を運転するに必要な溶媒約 7ℓ が収容できる。通常の測定条件では 4~5 日分の量に相当する。材質は SUS 316 の絞り加工品とし耐蝕性を向上させ、タンク内は必要に応じて N₂ パージも可能なようにした。

(2) レベルゲージ

溶媒タンク中の溶媒量を示すガラス管で脱ガス器より直接上方に出ており、外部よりレベルが見えるようになっている。

(3) 脱気装置

溶媒に溶解しているガスを昇温により除去するためのものでガラス槽を直接加熱する方式をとっている。脱気温度を正確に知るため液中に直接 pt 感熱体を取付けた。

通常は測定温度より 20~30°C 高く設定する。

(4) ラインフィルタ

ポンプの吸入側に設けた SUS 316 焼結フィルタでメッシュは 100 μ である。ここでは溶媒中のゴミを汎過し、ポンプのチェック弁内でのつまりを防止している。

(5) 定量小形ポンプ

高速 GPC に用いられるポンプは高分離能なカラム充

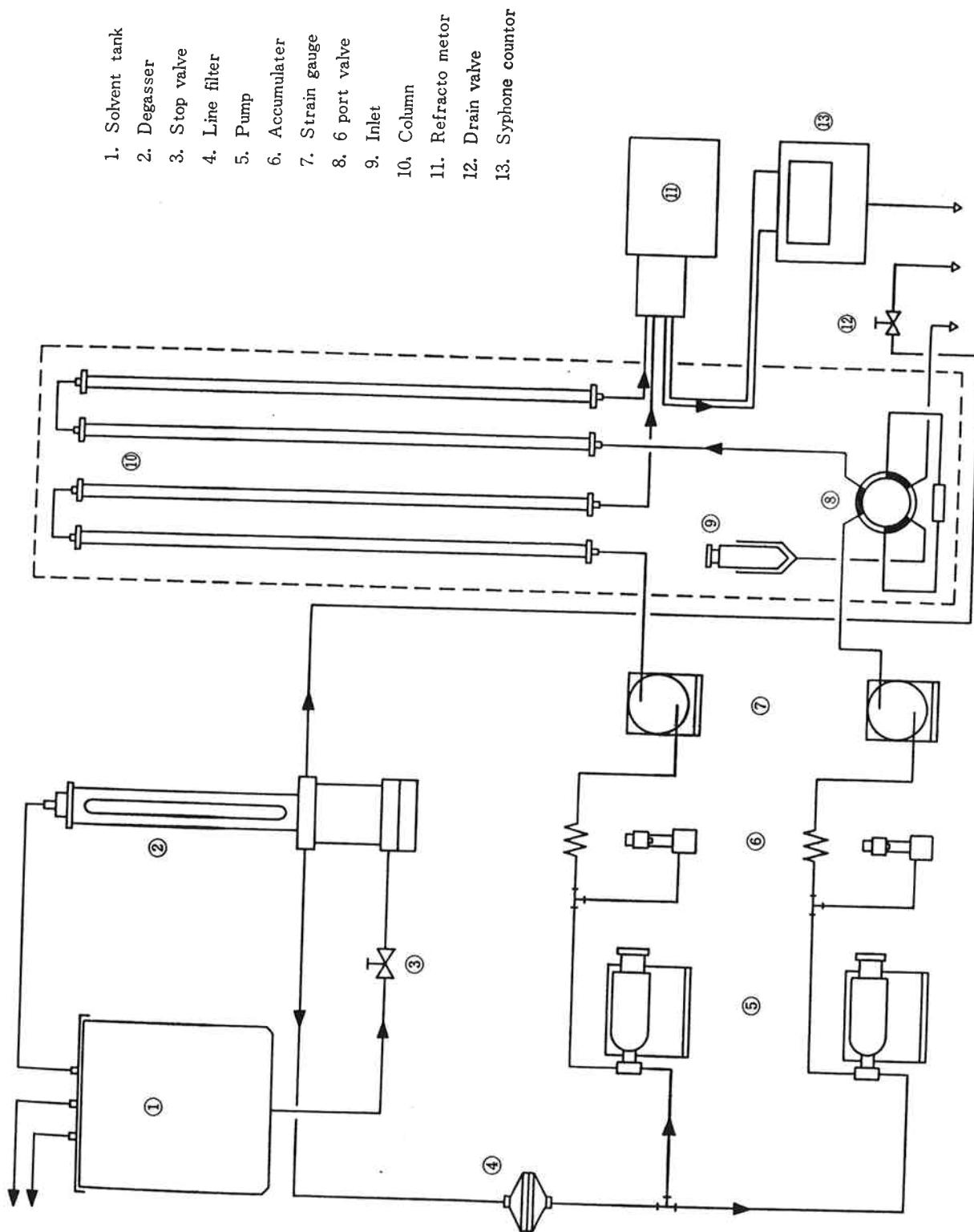


Fig. 2 Schematic diagram of flow system

てん剤の性能をフルに發揮させて定量性、再現性良いデータを得るために心臓部であり、検出器と合わせて最も重要な部分である。ポンプには定圧形と定量形とがあるが試料注入時のカラム内圧変化の影響を受けずに定量性あるデータを得るために定量形ポンプが望ましい。しかし従来この種の装置に用いられているような1ポンプシステムでは定量形ポンプと言えども定量性あるデータは得られないため本装置の場合は単動プランジャ往復形定量ポンプを2台使用し、レファレンス、サンプル各流路系を独立させるシステムを採用した。

単動プランジャ往復ポンプは、プランジャ軸と直角な軸のまわりに回転する偏心カムでプランジャ末端のフォロディスクを押して吐出ストロークを行ない、スプリングで吸入ストロークを行なう方式である。流量調整は、ディスクの帰りを制限することによって行なう。通常GPCで使用する流量は1.0~1.5 ml/minである。Fig. 3に接液部の構造を、Fig. 4に定量ポンプの構成を示す。

定量ポンプに要求されることは、吐出精度と耐久性である。耐久性については有機溶媒を長時間送液する面から弁、弁座、シール材など接液部の材質を考慮する必要がある。吐出精度はデータの再現性、分子量の計算に重要な意味をもち、少くとも0.3%以下の精度が要求される。定量ポンプを精度よく用いるには、まずその据付配管において、ポンプの吸入行程で液注分離を発生させないように必要な圧力NPSH(Net positive Suction Head)を考慮する必要がある。本装置の場合、溶媒にT.C.Bを用いたときNPSH avail 15.6 NPSH req 0.1で十分満足すべきものとなっている。一方定量性について考える時、その体積効率 η に影響する因子を考慮する必要がある。 η はつぎのように定義される

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_0}$$

Q_0 : 理論排水量 m³/s

Q_1 : 漏れ、逆流などによる減量 m³/s

Q_0 はプランジャの毎分往復数をnとする

$$Q_0 = \frac{V_n}{60}, V = \sum AL$$

A: プランジャ面積

L: ストローク

Σ : 送り出しを行なっているすべての作動面についての和

Q_1 は1つはプランジャシールやチェック弁からの洩れがある。この洩れ量を少くするためにはプランジャシールを工夫し、ボール弁の真球度を重視する必要がある。我々はTAYLOR HOBSONの装置を用い真球度

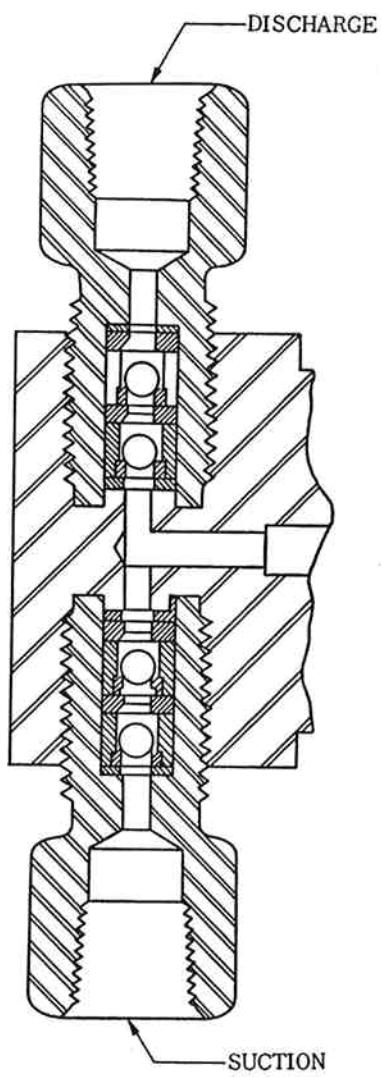


Fig. 3 Liquid part of controlled volume mini pump

を測定し0.14 μなる平均値を得たが、これは国産他メーカーの平均が0.2 μに対し良い結果であった。Fig. 5にその一測定例を示す。

Q_1 に影響する第2の因子は弁の閉じ遅れによる液の逆流である。吐出終りに瞬間にボール弁が着座しないと液は逆流し容積効率は低下する。弁の閉じ遅れはプランジャの往復回数に比例し、また、粘性、比重の大きい液では着座遅れが大きくなる。Fig. 6には吐出容積比に対する吐出圧上昇の時間おくれを調べた結果を示す。

吐出精度は Q_1 が液の粘性比重の関数であることより周囲温度の変化にも影響を受け、さらにはプランジャの往復回数に比例することよりポンプ駆動モータの回転数を常に一定に保つことも必要である。本装置に内蔵された状態での吐出流量精度をクロマトピークの保持時間の

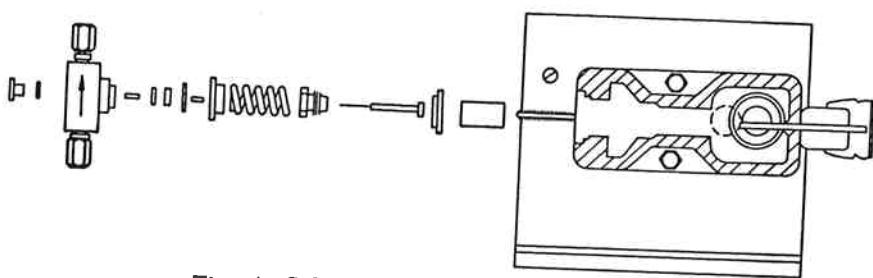


Fig. 4 Schematic diagram of mini pump

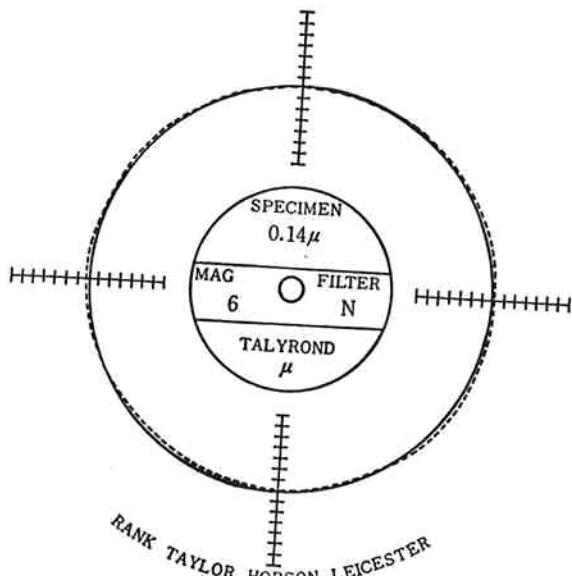


Fig. 5 Result of check ball

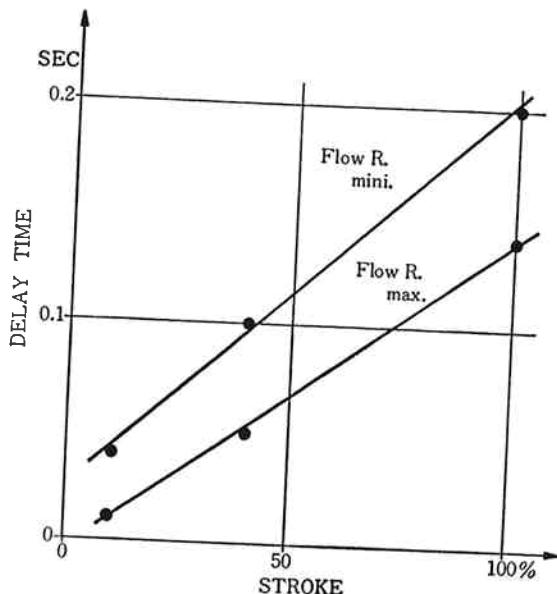


Fig. 6 Flow volume rate vs delay time

変化として調べた結果は平均偏差0.11%なる値を得た。とくに高温 GPC の場合は流量変動のセルへの影響が非常に敏感であるから、以上のべたような諸点については細心の注意をはらう必要がある。

なお Fig. 7 に本装置の特長である 2 ポンプシステム

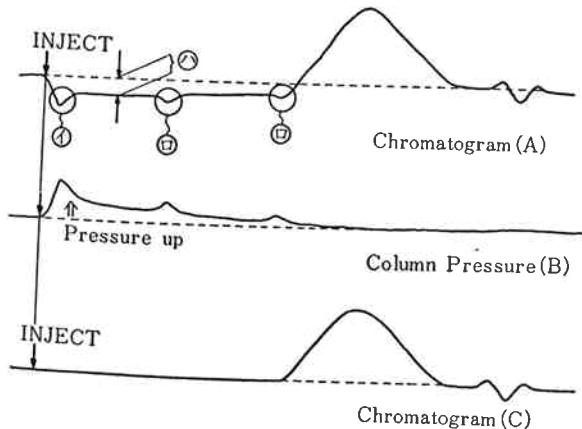


Fig. 7 Chromatogram of polyethylene

を 1 ポンプシステムと比較した場合のクロマトチャートを示す。

(6) アキュムレータ

使用ポンプがプランジャー往復運動であるため必然的に脈動を生じる。この脈動を吸収し、サンプルポンプの開閉によるサージ圧を吸収し平滑な送液を得るためにアキュムレータを用いる。高温 GPC に用いるアキュムレータとしては、脈動吸収、サージ吸収といったことの他に、高耐圧、溶媒交換が容易、さらにはデッドボリュームが小さいことが要求される。アキュムレータにはブルドン管形、スプリング形、ペロー形、水銀形などがあるが、試料注入時のカラム内圧変化にすぐに対応するためにはデッドボリュームの小さなものが要求される。

HLC-811 に用いているアキュムレータはブルドン管形で効果を上げるため細管による抵抗体との組合せで用いている。Fig. 8 はアキュムレータによる脈動除去の様子を示したもので(1)がアキュムレータのない場合、(2)がブルドン管のみで構成した場合、(3)が本装置に用いているブルドン管と抵抗体の組合せによる場合の結果を示し

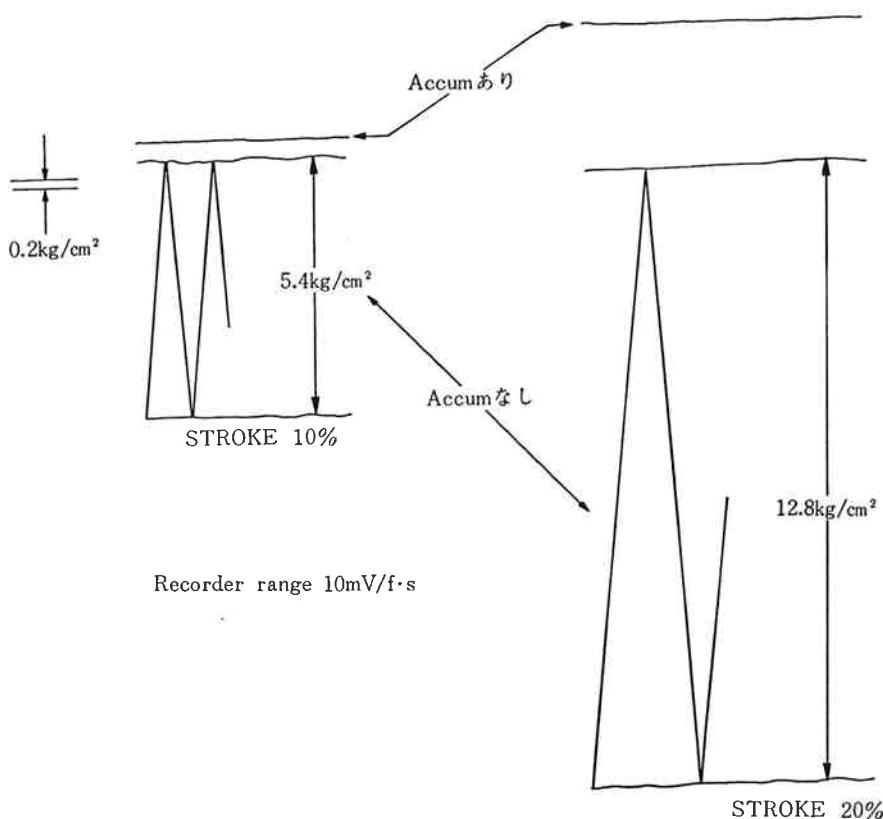


Fig. 8 Operation of accumulator

た。

(7) 圧力モニタ

レファレンス流路、サンプル流路それぞれの液圧を示し、かつ不測時の液圧上昇時に安全弁の代わりをする保護回路を有する圧力モニタがあり、それぞれのポンプと連動している。圧力モニタとしては従来ブルドン管式のゲージが用いられているがブルドン管内部の液交換がやりにくく、ポンプの性能あるいはアクチュレータの性能をゲージから読み取ることは難しいなどの点を考慮し、本装置の場合は半導体ひずみゲージを用いた。

応力やひずみを測定するには、従来抵抗線ひずみゲージがよく使われる。これは外力を受けて線が伸縮し、断面積が変化することによる電気抵抗の変化を利用する。これに対し半導体ひずみゲージは、形状変化による抵抗の変化は小さく、外力を受けるとそれに応じて結晶そのものの固有抵抗が変わる現象——これをピエゾ抵抗効果と言う——を原理にしている。Ge, Siなどの半導体の単結晶はピエゾ抵抗効果が大きいので、これらを素材にした半導体ひずみゲージは小さな外力を受けた場合でも大きな出力が得られる。HLC-811に用いられているものはシリコンの単結晶にインジウムやホウ素など3価の元素をごく微量混入したP形で、標準抵抗値 120Ω のも

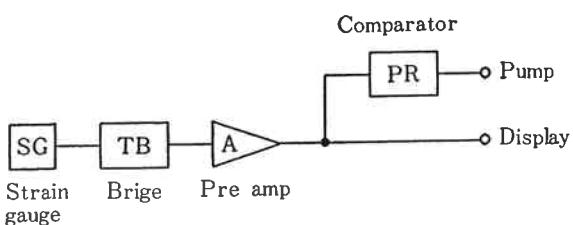


Fig. 9 Schematic diagram of pressure monitor

のを使用し、温度補償回路、計測アンプ、ポンプ保護回路を組合せ、アナログにて表示している。

Fig. 9 に回路の概要を示す。

[2] オープン系

オープン系は熱風発生機、カラム槽、試料注入部を有する。オープンは温調器により一定の操作温度に維持される。

(1) 热風発生機

カラム槽内の温度分布の均一化、槽内温度の立上がり特性の改善、さらにはカラムエンドや配管からの洩れによる溶媒が直接加熱源に触れることを防ぐため HLC-811 ではカラム槽と熱源とを分離する方式を採用した。熱風発生機は熱源に効率のよいコイルフィンヒータ容量 200 w のものを 8 本用い、内 6 本を MAIN ヒータと

し、残り 2 本が予熱用 PRE ヒータとして用いている。MAIN と PRE ヒータの制御は温調器内のコンパレータにより行なっている。熱風発生機の構成を Fig. 10 に示す。

(2) カラム槽

カラム槽内には $\frac{3}{8}$ インチ、長さ 2 フィートのカラム

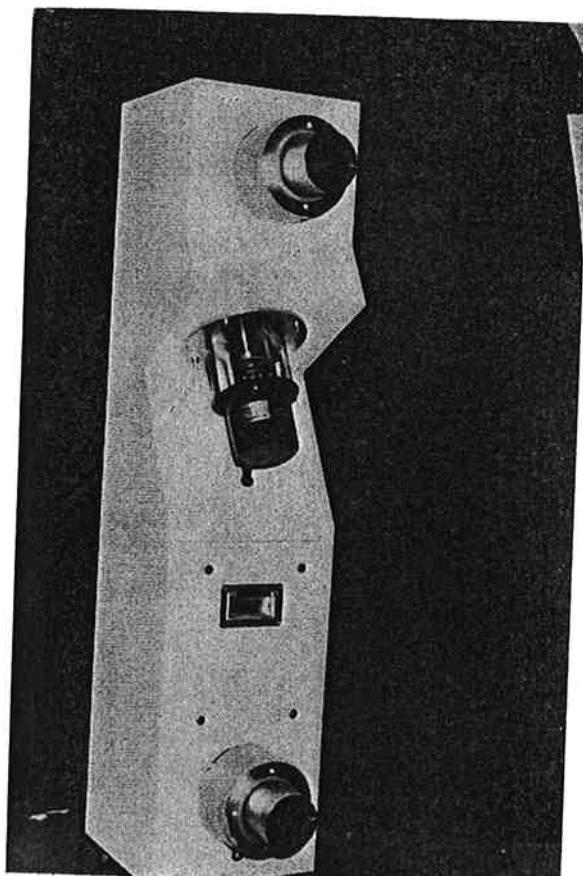


Fig. 10 Heating box

6 本とプレカラム 2 本が収納される。槽内の温調精度は、ヒータ温度 t と槽内空気温度 ta の差を出来るだけ少くする必要がある。この差 ($t-ta$) は、平衡状態における熱入力 H に比例し、気流速度の $\frac{1}{2}$ 乗に逆比例するため、空気循環機構による摩擦、じょう乱などに対し充分大きな気流速度を得る必要がある。HLC-811 カラム槽の温度を 135°C に設定した場合の立上時間を Fig. 11 に示す。安定後の槽内温度分布はカラムの上端と下端間で 1°C 以内であり、精度は 0.1°C 以内であった。

(3) 試料注入部

試料注入部は試料注入孔 (Sample inlet) とサンプルバルブ、サンプルループとから成る。これらはすべてカラム槽内に収納されカラムと同一温度に保持される。

試料溶液をサンプルループ（通常は容量 2 ml ）に詰めるには注射筒を用い注入孔より注入する。サンプルバルブは 6 方バルブで VALCO 社の高温用を用いている。このバルブは 200°C において 1000 psi の耐圧があり本装置の仕様を満足している。

Fig. 12 に試料注入部を示す。

[3] サイフォン系

ガラスサイフォン、光源、検出器とアンプ回路より成

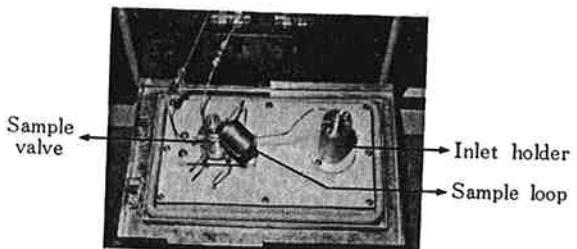


Fig. 12 Sample injection part

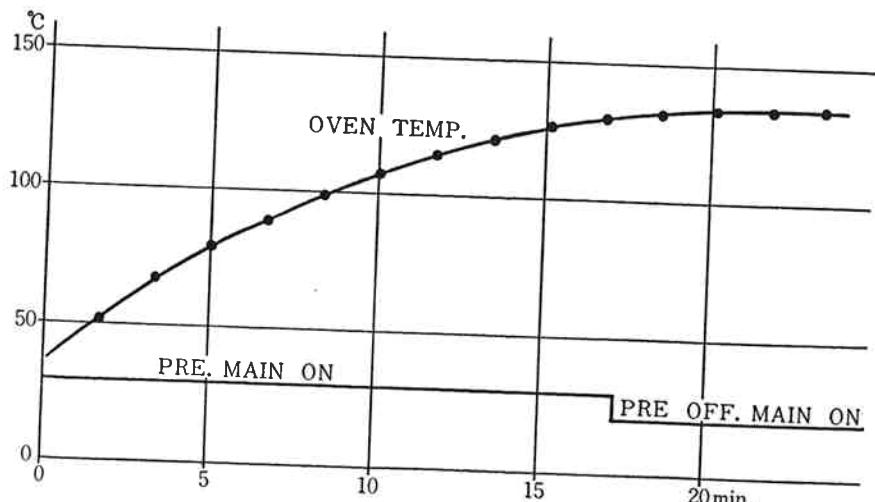


Fig. 11 Temp. up curve of oven

る。屈折計を出たサンプル流路の溶液はガラスサイフォンに流下する。2 ml たまるとサイフォン効果により液は流れ出しサイフォンは空になる。流れ落ちる液は光源からの光を横切り、光束は収束しフォトセルにより検知される。この信号を増巾し 2 ml 每に記録計にマーカ信号を記入している。サイフォン系も操作温度に昇温できる様、ヒータが格納されている。サイフォン周辺の温度はかなり上昇するため、光源と検出器は別の位置に設置され、それぞれオプティカルファイバによってサイフォンガラスの流下部に導かれている。

Fig. 13 にサイフォン系を、**Fig. 14** に概略構成を示す。

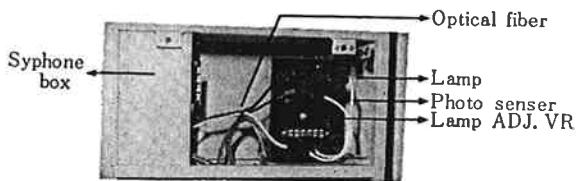


Fig. 13 Syphon system

[4] 示差屈折計 (Differential Refractometer)

屈折とは1つの物質から他の物質へ光束が通る時、光束が曲る効果を言う。屈折計はこの効果を測定し、屈折率は、沸点、冰点、密度などと同じように各物質の物理的な基本定数である。屈折計には、ある屈折率 n_1 の物質からある屈折率 n_2 の物質に光束が入射角 i で入射し屈折角 r で屈折するとき $\sin i \cdot n_1 = \sin r \cdot n_2$ の関係が成立する。これを Snell の法則と呼び、この原理を利用して偏光形屈折計と、反射率 $R = \frac{\tan^2(i-r)}{\tan^2(i+r)}$ で示される Fresnel の反射式を利用したフレネル形屈折計とに大別される。HLC-811 に用いた装置はフレネルの振巾

反射の法則による光学原理を用いたもので、溶媒がフローセルに注入されると、プリズムと溶媒によって平面状の界面が形成され、その界面に平行光線を照射するとプリズムの屈折率と溶媒の屈折率の関係によって定まる反射率で平行光線の一部がホトセンサに入る構造になっている。ここで溶媒の屈折率が異なれば反射率も変化するので屈折率の変化が検知できる。示差屈折計とは上記の原理を利用し、フローセルを平行に2つ形成しその差を求めるようにしたものである。

示差法がすぐれている点は、レファレンスとサンプルの信号の差をとることによって、光源のフラッキや溶媒の温度変化などをキャンセルすることが可能であり、より微少な屈折率変化まで測定が可能である。

理想溶液の場合、溶液の屈折率 n_{sol} は

$$n_{sol} = c_1 n_1 + c_2 n_2$$

但し c_1, c_2 : 溶媒、溶質のモルパーセント、

n_1, n_2 : 溶媒、溶質の屈折率、

また Gladstone-Dale によると、溶液の屈折率の濃度依存は $\frac{\partial n}{\partial c} = R_2 - \frac{\rho_1}{\rho_2} R_1$ で示される。

c : 溶液濃度 g/cc

$$R_1 = (n_1 - 1)/\rho_1, R_2 = (n_2 - 1)/\rho_2$$

ρ : 密度 n : 屈折率

$\partial n / \partial c$ の値は溶媒および溶質高分子の組み合わせに応じて温度が定まれば一定の値をもつ。すなわち溶液の屈折率はその濃度に直線的に比例し、これはまたカラムより分離された試料高分子の Mi・Ni に比例するとみられる。

Mi : 成分高分子の分子量

Ni : その成分の個数

示差屈折計は溶媒と分離された成分高分子を含む溶液との屈折率の差から、成分濃度ひいては相対的含有量を知ろうとするものである。

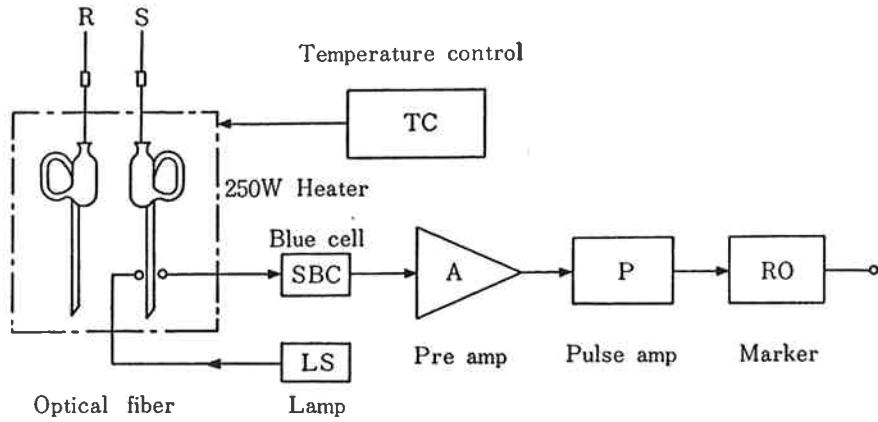


Fig. 14 Schematic diagram of syphon monitor

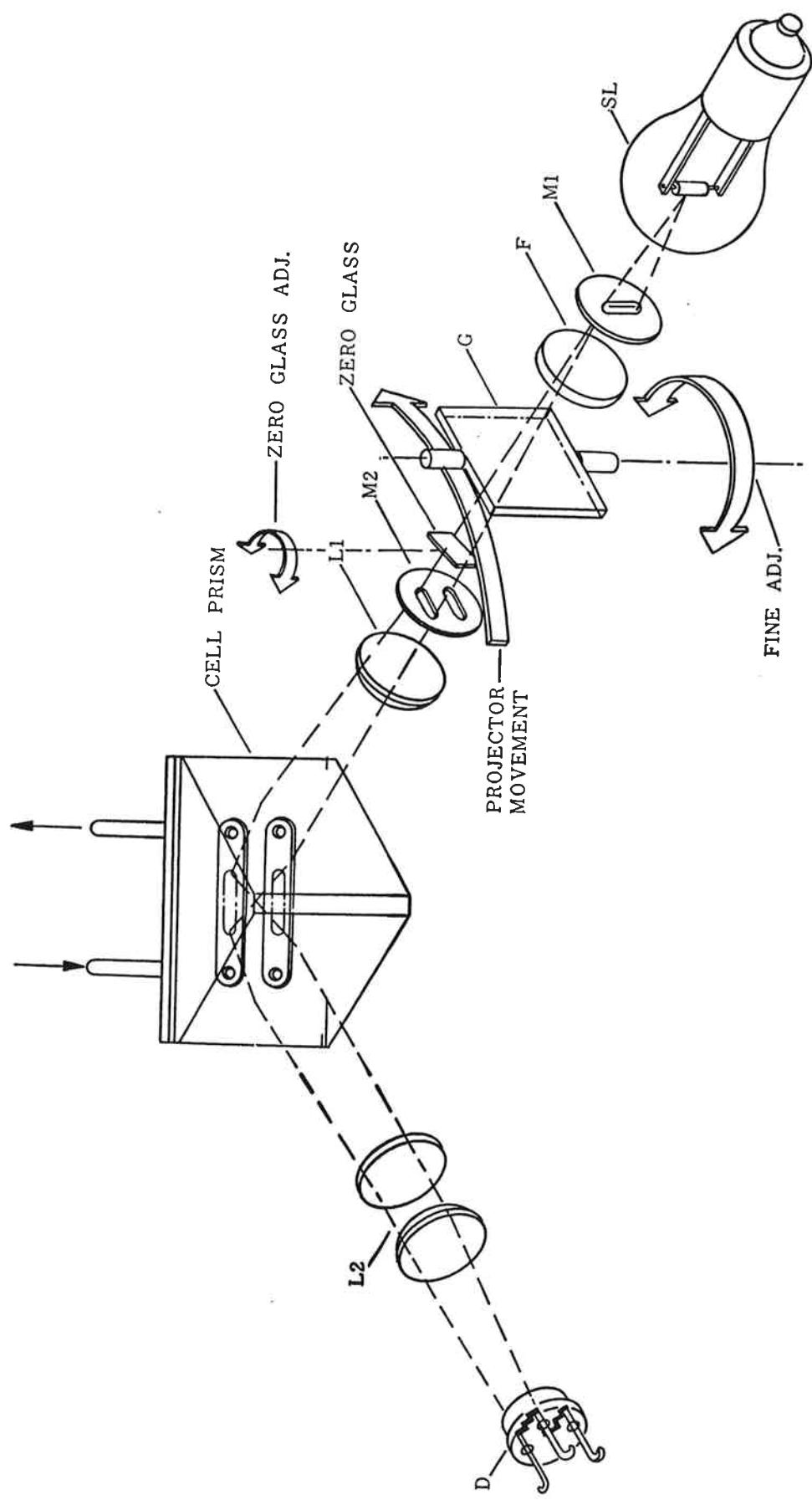


Fig. 15 Schematic diagram of optical system

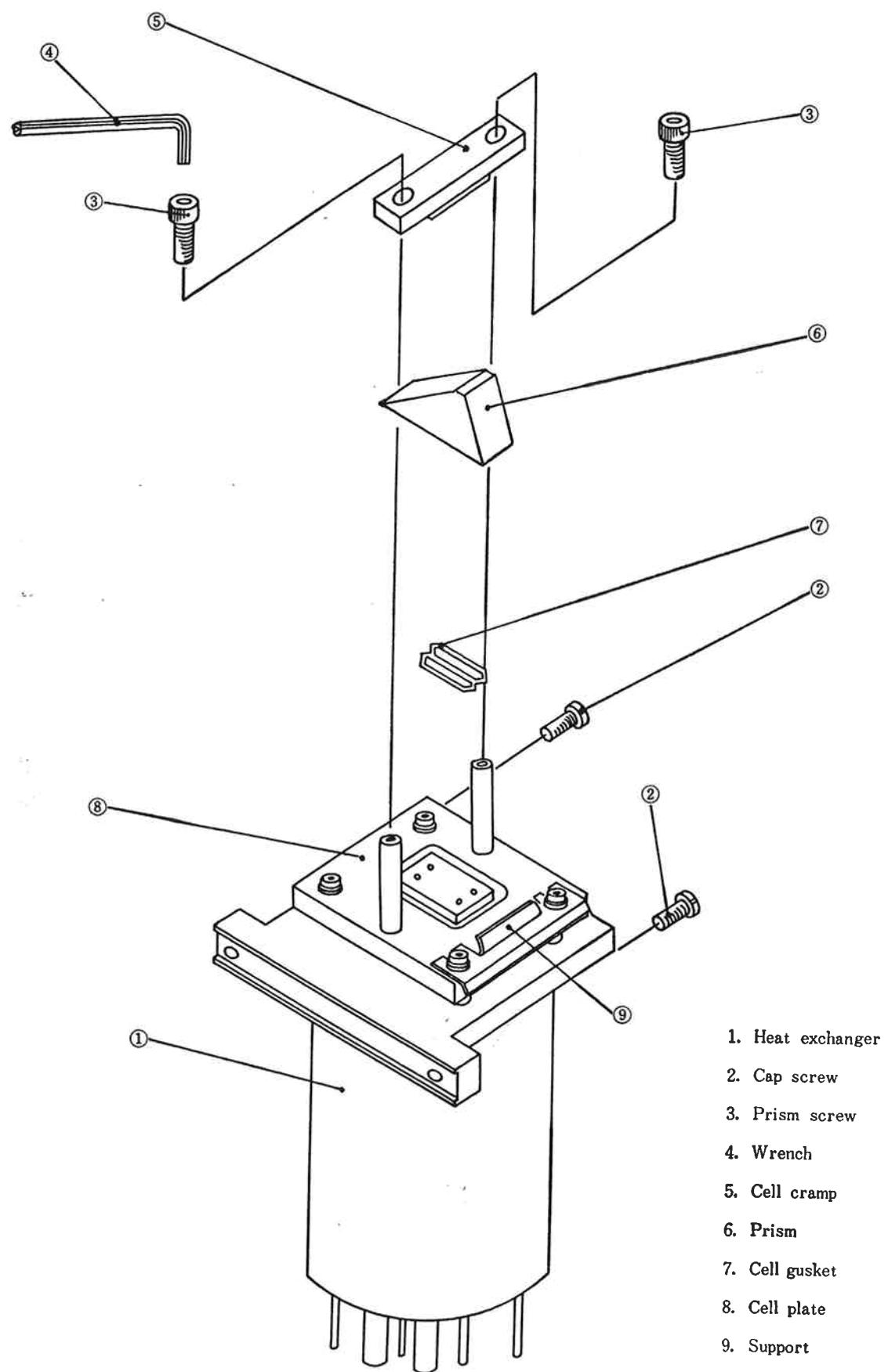


Fig. 16 Schematic diagram of flow cell

Fig. 15 に光学系を **Fig. 16** にフローセル部の概要を示す。

光源ランプ (SL) から出る光はソースマスク (M_1) 赤外線遮蔽フィルタ (F), 微調整ガラス (G), ゼロ調ガラス (Z), 開口マスク (M_2) の順に通過し, レンズ (L_2) により照準される。マスク (M_2) によって形成された 2 本の平行光線は, セルプリズムに入り, **Fig. 15** の様に液面のガラス上に照射される。サンプルとレファレンスのチャンバは, セルプリズムとステンレスの, プレートで締めつけられている薄いテフロンガスケットで構成される。SL から L_1 はいわゆるプロジェクタとして独立した光学ベンチに設置され, それぞれ個別の屈折率をもつ溶媒に適応させるための入射角の調整を, このプロジェクタの支点を中心にして移動させて行なっている。入射角の微調整は, 微調整ガラス (G) を回して行なう。このガラスは光源ランプをわずかに移動することと同じ効果をもち, 入射角をごくわずか変えることができる。

液とガラスの界面で反射される二つの平行光線はレンズ (L_2) に入ることなしに放光され, 1 対の液とガラスの界面を透過した光線は, 薄い液膜を通過し, セルプレートに照射する。セルプレートは光が表面で拡散するよう研磨しており, 透過光は 2 つの光のスポットとなる。レンズ (L_2) はこれ等のスポット像をデュアルフォトセルの感光素子上に形成する。

入射角が, 両方のセルチャンバの溶媒に対して臨界角より僅かに小さく調整してあるとき, 等量の光がデュアルディテクタ (D) の両方の素子に照射されており, ここで一方のチャンバの液体の屈折率が変化したとすればフレネルの法則に従って, 全入射光線 I_0 と反射光線 I_r の割合が変化する。

$$\frac{I_r}{I_0} = T = \frac{1}{2} \frac{\sin^2(r-i)}{\sin^2(r+i)} + \frac{1}{2} \frac{\tan^2(r-i)}{\tan^2(r+i)}$$

その結果, デュアルディテクタの各々の素子上の光の照射量は同じでなく, 二つの液体間の屈折率の差となって表われる。

Fig. 16 の熱交換機 (Heat Exchanger) はサンプルおよびレファレンスの両液がセル室に入る前にその温度をセル室温度と同一にし, 屈折率の温度による影響をおさえるためのものである。これは後でも述べるが, 温調エレクトロニクスにより制御される。

HLC-811 に用いた示差屈折計の仕様を **Table 1** に得られた結果のうち, 感度分布曲線を **Fig. 17** に, 各設定温度におけるノイズを **Fig. 18** に示す。

[5] 温度制御

高温 GPC の場合, その測定対象が高温溶媒でなければ溶解しないので装置の試料注入からサイフォンを通して廃液するまでの全系を昇温しなければならない。

昇温限界はポリスチレンゲルの分解を考え 150°C に抑え万一温調器の暴走に備え Sensbey による 2 重安全構造とした。GPC 溶出曲線のベースラインは各昇温部の温度の影響を敏感にうける。これは溶液の dN/dT あるいは $d/dT (dn/dc)$ が $10^{-5}/^\circ\text{C} \sim 10^{-4}/^\circ\text{C}$ の桁でかなり大きいこと, 温度が変化すると溶液の粘性抵抗や密度が変化し, これが負荷変動となり, セル室での流量バランスがくずれることに原因すると考えられる。

HLC-811 の温度制御は, オーブン, セル, サイフォン, ディガッサ部で SSR (Solid State Relay) を使用した ON, OFF 制御方式をとっている。温度検出には 0°C で 100Ω の抵抗値をもつ白金感熱体を用い, P.I.D 動作を盛り込んだ回路構成となっている。

Table 1 Specification of RI monitor

1	Refractive index limit	1.40~1.55
2	Minimum detection	5×10^{-8} RIU
3	Flow cell volume	$5 \mu\ell$
4	Concentration sensitivity	$1.5 \mu\text{g}/\text{m}\ell$
5	Range	$0.5 \times 10^{-5} \sim 128 \times 10^{-5}$ 9 レンジ
6	Drift	1×10^{-6} RIU 以下
7	Temp. setting	$50 \sim 150^\circ\text{C}$
8	Power	AC 85~115v 50/60Hz 200W
9	Recorder	10mv

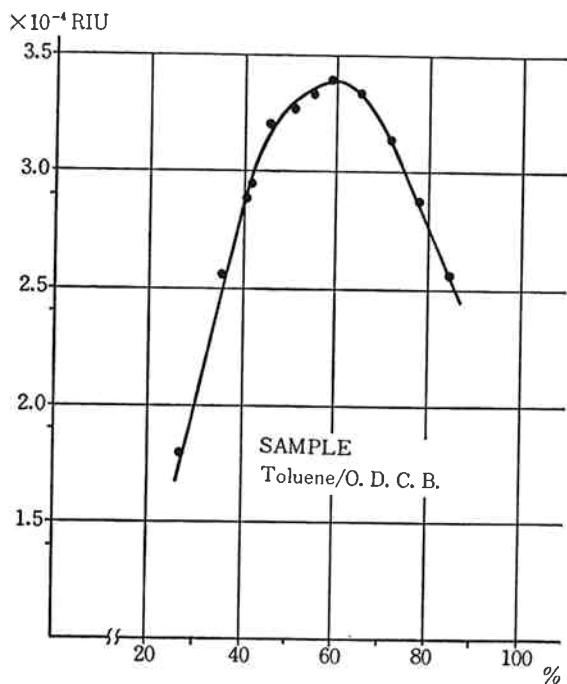


Fig. 17 Sensitivity curve of refractometer

(1) 白金測温抵抗体用リニヤライザ回路

白金測温抵抗体は高精度で安定な温度検出素子であるため工業計測に多く使用されている。しかしその抵抗値変化は温度に対して直線関係になく抵抗比例の出力を得られる回路を用いても数%の誤差がある。HLC-811 の

場合、温度の設定をダイヤル直読方式としたため Fig. 19 に示すようにリニヤ IC と数個の抵抗を用い、測温体に加える電流をその抵抗値により変化するように回路を構成して、温度に比例する出力を得ている。

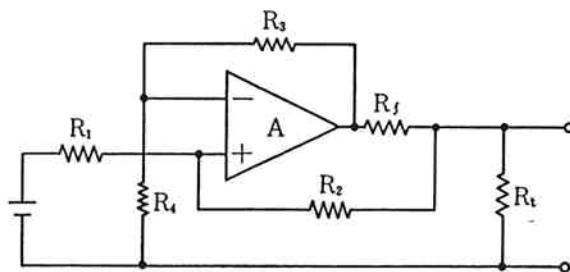


Fig. 19 Linealyzer amp

(2) 温度制御回路

白金測温抵抗体の抵抗値 R_t と温度 t の関数は近似的に次式で与えられる。

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t + \beta t^2)$$

$$\alpha : 3.9752 \times 10^{-8} / ^\circ C$$

$$\beta : 5.888 \times 10^{-7} / ^\circ C$$

この抵抗値の変化をリニヤライザ回路により、抵抗値 R_t の増加にともない測温体に加える電流 i_t を増加させ感度の減少を補い温度に比例した出力電圧を得る。この出力電圧は TEMP. SET. AMP. により設定温度 R_T と

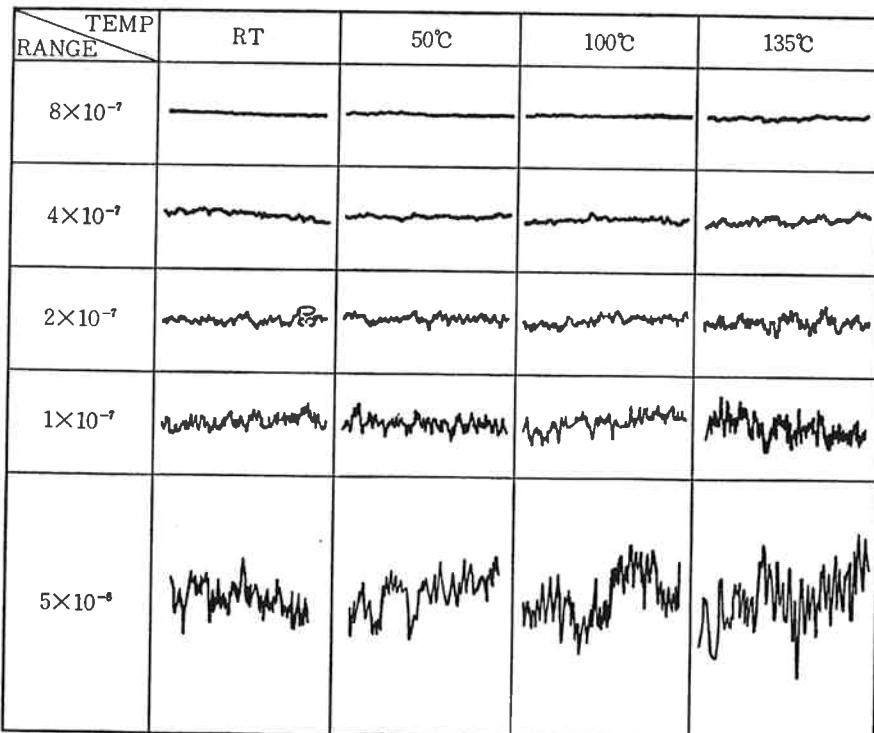


Fig. 18 Noise level of RI monitor

R_I が比較される。比較後の出力電圧は C_d, R_d によって構成される微分動作時間の設定 (6~60 sec) を行ない次段の増幅器のフィードバックゲイン R_P により 0.1~10 deg の比例帯を設定し、更に C_I, R_I による積分動作 (5~500 sec) を加えたのち SSR の点弧角変化の前処理としての鋸歯波との比較をされ SSR 駆動アンプを通したのち SSR に接続される。

SSR は信号系に発光素子と受光素子を組合せた光結合素子を用い、負荷側からのノイズは入力信号源側に回り込まず安定に動作する。またサイリスタの点弧は交流電源のゼロ電圧付近でおこなわれる所以サイクルの途中で入力信号が入っても次のゼロ電圧付近まで遅れてから動作する。従ってスイッチングノイズや過渡電圧および突入電流が極力抑制されるので他の機器への悪影響がない様になっている。Fig. 20 に温調エレクトロニクスの概要を示す。

(3) 各部温度調整と精度

高温 GPC 装置で温調精度をもっと必要とするのは示差屈折計である。HLC-811 の場合は熱交換機とフローセル部の温度を同一にするため一体構造とした。屈折計はきわめて高感度で屈折率差 10^{-7} を検出し得るものであり一方溶媒の屈折率の温度係数は溶媒によって異なるが略々 $5 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 程度であることから、屈折計検出感度から計算して $2 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}$ の温度精度を必要とする。つぎに考えなければならない点は屈折計の光学系内の温度である。空気の屈折率の温度係数は $1 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 程度であるから系内の温度が対流とうによって変化すると光束がゆらぎ、ベースライン上にノイズとなってあらわれる。HLC-811 ではこの点を考慮し光学系を格納する部分については系内の空気の動きを極力押えると同時に格納容器を恒温水によって常に一定に保たれる配慮を行なっている。

つぎにカラムオーブン槽内の温度であるが、充てんカラムの抵抗は充てん物質の粒径、送液の粘性係数、カラム長などによって決まると言われているが、これらが温度

の関数であるところからオーブン槽内の温調も重要である。

オーブン槽内にはサンプル、レファレンス両流路があり、槽内の温度変化に対し全く同じに流路抵抗が変化するわけではないので、両カラム系に流れる流量が変化し、ベースラインを乱すことになる。この様なことからオーブン槽はカラムの上下端における温度分布が 1°C 以下でその精度が $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 程度が要求される。

その他のサイフォン、ディガッサ部の温調もベースラインのうねりやドリフトに相当の影響をもつため本装置ではすべて P.I.D 動作を加味した温調器を採用し万全の配慮を行なった。

3. 結果と考察

[1] 総合性能について

(1) 装置立上時間

装置の運転開始から測定可能なベースラインを得るまでの時間を立上時間と呼んでいる。通常の場合、カラム内の前液がすべて送り出されるまでの時間以内にすべての昇温系が安定している必要がある。HLC-811 の場合 RI の熱交換機は30分、オーブン槽25分、ディガッサ40分、サイフォン40分で室温から 135°C まで昇温される。ベースラインの安定はこれら昇温系が設定温度になり、カラム内の溶媒が置き変わったのちに安定するはずであるが前述した様に RI 検出器の光学系内の空気温度が一定にならないと安定したベースラインは得られない。この光学系内の温度を早く安定にするために検出器外箱を $10\sim 15^{\circ}\text{C}$ にて水冷循環させた場合は約1.5時間でベースラインは安定するが、水冷循環のない場合は約3.5時間を必要とした。

(2) ノイズ

ノイズの原因となるものはホトセンサの熱雑音や光学系内の熱ゆらぎがある。本装置の場合ノイズは設定温度によって異なるが、温度 50°C 設定では 1×10^{-7} RIU、 100°C では 1.5×10^{-7} RIU、 135°C で 2×10^{-7} RIU 程度

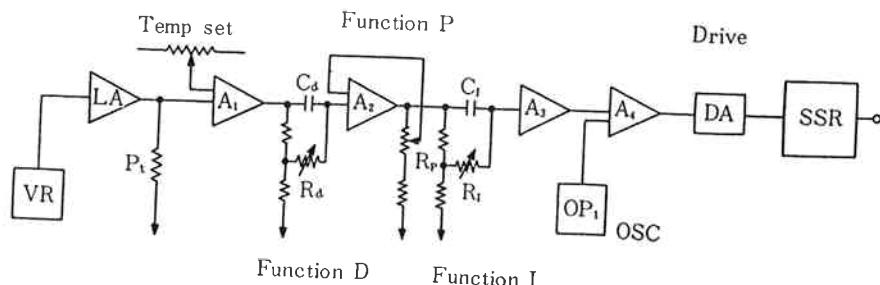


Fig. 20 Temperature controlling electronics diagram

であった。

(3) ベースラインドリフト

ベースラインのドリフトやうねりは設置場所の温度変化に左右される。ここでは室内温度変化 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の環境下においてテストした結果 $8 \times 10^{-7} \text{ RIU}/\text{時間}$ を得た。測定条件は、温度 135°C 、溶媒に O.D.C.B. を用い流速 $1.2 \text{ ml}/\text{min}$ 、カラムは GMH4 2本を用いた。

[2] カラム性能について

(1) 溶媒置換

高温 GPC で用いられる溶媒は 1, 2, 4 T.C.B. や O.D.C.B. が普通である。従来からこの種の溶媒用カラムはアセトンにて充てんがなされているため使用前に溶媒置換をする必要がある。溶媒置換に際してはカラムの充てん状態を極力変化させないため $0.5 \text{ ml}/\text{min}$ 以下の流速で室温状態で置換し、その後 135°C に昇温しトルエン 1% 溶液にて理論段数を、標準ポリスチレン 126万と

10万の等量混合物 0.05% 溶液にて分離能を調べた。

この結果 GMH 3 で 3800 TP/F , GMH 4 で 4800 TP/F を得、慎重に溶媒交換を行えば問題ないことを確認した。

(2) カラム耐久テスト

溶媒に 1, 2, 4 T.C.B., O.D.C.B. を用い、温度 135°C にて通常の使用状況にてテストランを繰り返し、カ

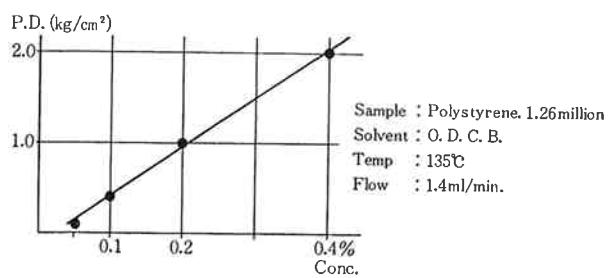


Fig. 22 Column Pressure drop vs concentration

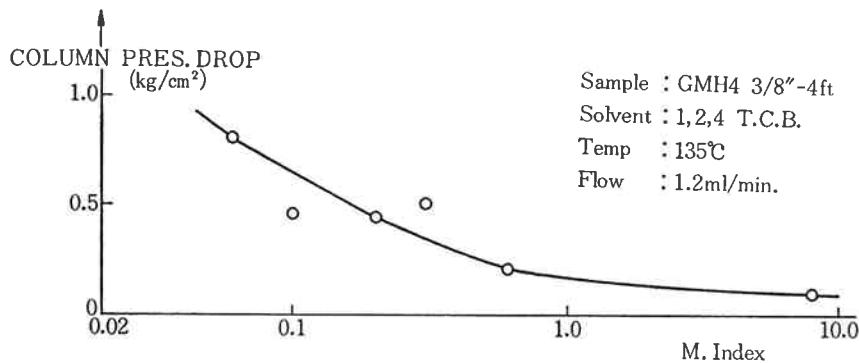


Fig. 21 Result of each samples

Instrument : HLC-811
Sample : PE
Sample Size : $2\text{mg}/\text{ml}$ $2000\mu\text{l}$
Column : GMH4
Column Size : $3/8''$ 4 ft
Mobile Phase : O.D.C.B.
Flow Rate : $1.5\text{ml}/\text{min}$.
Pressure : $8\text{kg}/\text{cm}^2$
Temp : OVEN 135°C
Detector : DETECTOR 135°C
Detector : RI $\times 8$ 100mV
Chart Speed : $12\text{mm}/\text{min}$.

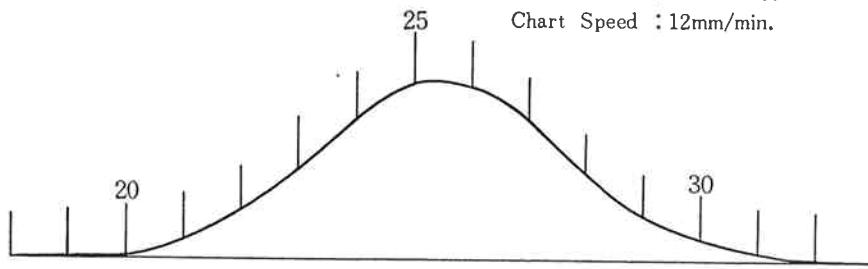


Fig. 23 Chromatogram of polyethylene

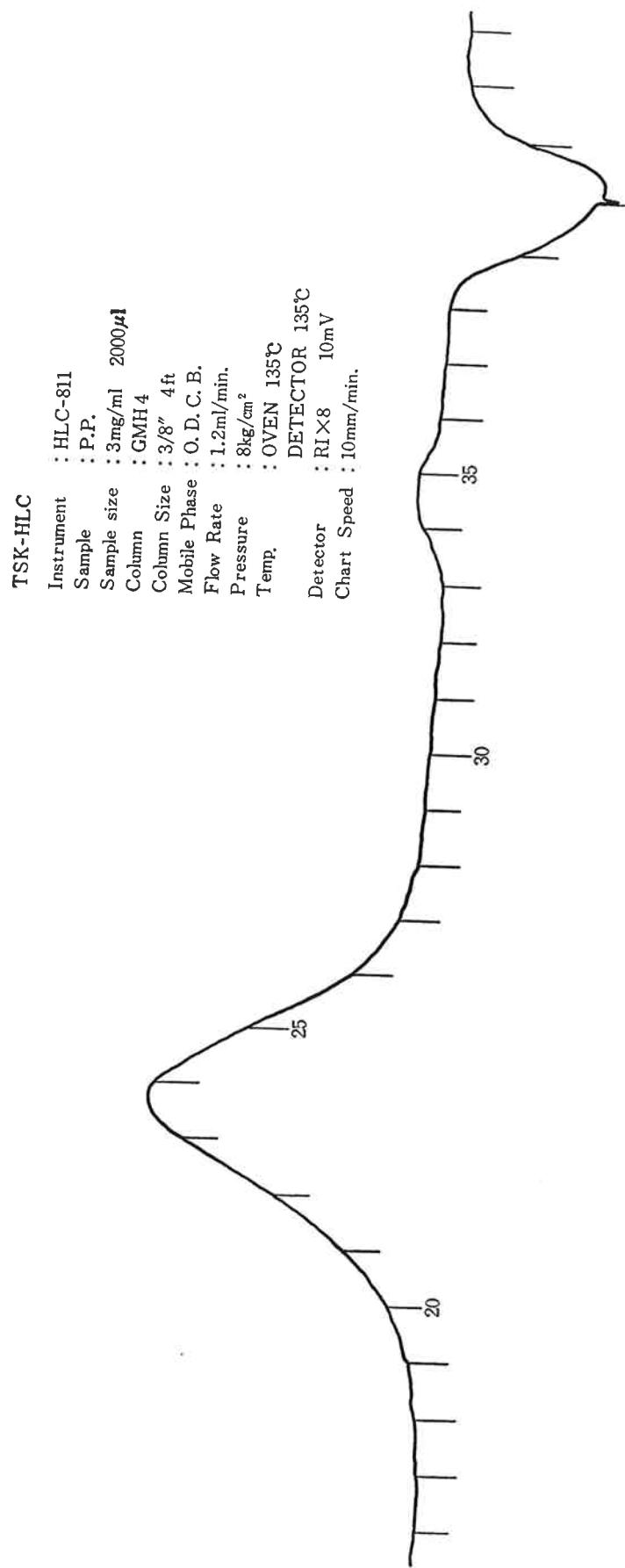


Fig. 24 Chromatogram of polypropylene

ラムの劣化程度を調べた。

一番長く使用したのは GMH 6 (C060221, C060224) で当初 6800 TP/F であったものが 2年間テストランのうち 5200 TP/F に劣化した。

カラムの耐久テストで気付いた点は溶媒置換後、約1カ月のテストランで劣化しなかったカラムは少くとも6カ月以上は安定に使用出来ることが確認された。

(3) 試料注入によるカラム内圧の変化

カラムに GMH 4, 2本を用い溶媒に 1, 2, 4 TCB, 温度135°C, 流速 1.2 ml/min の条件で高圧, 中低圧法ポリエチレンのメルトイインデックスの異なる試料を濃度0.2%で注入した結果 Fig. 21 に示すような結果となつた。

シングルポンプ系では MI 0.1 以下よりベースラインの段差があらわれるが、デュアルポンプ系では異常は見られなかつた。

また Fig. 22 は試料に標準ポリスチレンの分子量126万のものを用い、濃度を0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4%と変化させた場合のカラム内圧変化を示したものである。

[3] 測定例

溶媒に O.D.C.B. を用い温度135°C, 流速 1.5 ml/min, カラム GMH 4 を用いて測定した例のうち、ポリエチレンの例を Fig. 23 に、ポリプロピレンの例を Fig. 24 に、またこのカラム系の標準ポリスチレンによる検量線を Fig. 25 に示す。

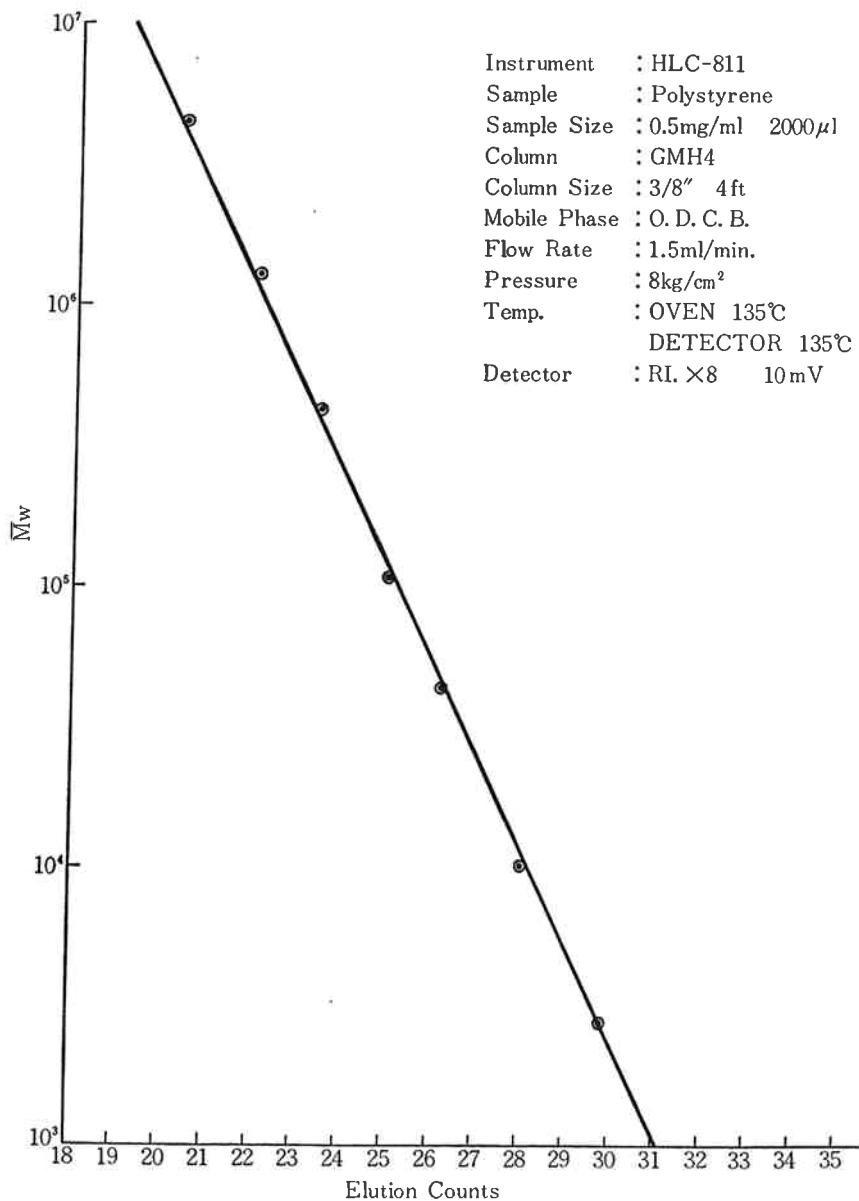


Fig. 25 Calibration curve of polystyrene

4. む す び

2年間の長期にわたり高速、高温 GPC の開発を行なってきたがようやく商品化のはこびとなった。開発に着手以来、送液系においては定圧ポンプから定流量ポンプへ、シングルポンプ系からデュアルポンプ系への変更を、サンプルバルブは4種、10個の試作検討、流量モニタはロータリサイフォンなど3種、熱風発生機とオーブン槽は槽内温度分布の均一化のため3種、屈折計においてはフレネル形、ルマ・ゲーリケ形など実際に数多くの試作検討を加えたために大幅に商品化のスケジュールが遅れ関係方面に多大の迷惑をかけたことをお詫びする。本報告では初期の目的である測定時間1時間以内、装置の

安定時間2時間以内で高温 GPC の測定が行えることは達成できた。しかし GPC の根本原理には未解決の点も多く、かつ装置も従来の分析器に比べ安定で使い易いものではない点、今後更に改良していく必要があると考えられる。

本報告は主として装置の構成、原理について述べたが GPC の原理については刊行されている文献を参照願いたい。最後に、東洋曹達 HLC-811 形の開発研究に尽力いただいた方々は東洋曹達研究所の相浦 淳、商品開発販売部の鈴木慈雄、開発研究所の木戸士龍、旭計器工業の山本勝重、吉田 清、齊藤 学の諸氏であり厚く感謝の意を表したい。